doi: 10.3969/j.issn.1007-9289.2010.03.005

溅射参数对 CuInGa 预制膜成分和结构的影响*

李春雷,庄大明,张 弓,宋 军 (清华大学 机械工程系,北京 100084)

摘 要:作为 CIGSe 太阳能电池重要组成部分的 CIGSe 吸收层可以采用预制膜+硒化两步法制备。文中采用磁控溅 射方法制备了成分均匀、具有一定成分比例的 CuIn、CuGa、CuInGa 预制膜。X 射线荧光分析(XRF)结果显示随着 溅射电流的增加, CuIn 预制膜的 Cu/In 原子比减小, CuGa 预制膜的 Cu/Ga 原子比保持不变; X 射线衍射分析(XRD) 结果表明 CuIn、CuInGa 预制膜主要由 Cu₂In、CuIn、In 相组成,Ga 元素以固溶的形式存在于 CuInGa 预制膜中。对于 CuIn 预制膜,随着溅射电流的增加,薄膜中的 Cu₂In 相逐渐向 CuIn 转变。

关键词:太阳能电池;CIGSe;磁控溅射;预制膜;CuInGa

中图分类号: TM615 文献标识码: A 文章编号: 1007-9289(2010)03-0025-04

Influences of Sputtering Parameters on the Composition and Microstructure of CuInGa Precursors

LI Chun-lei, ZHUANG Da-ming, ZHANG Gong, SONG Jun (Department of Mechanical Engineering Tsinghua University, Beijing 10084)

Abstract: As the crucial part of CIGSe solar cell, CIGSe absorber can be prepared by an approach which can be called two-step process combining precursor deposition and selenization. In this work, CuIn, CuGa and CuInGa precursors with uniform compositions and certain atomic ratios were prepared by magnetron sputtering. XRF results show that the atomic ratios of Cu/In in CuIn films decrease with the increasing of sputtering current while the atomic ratios of Cu/Ga keep constant. XRD results show CuIn and CuInGa precursors mainly consist of Cu₂In CuIn and In phases, while Ga exists in CuInGa films in the form of solid–solution. For CuIn precursors the peaks of CuIn phase appear as the sputtering current increases, which indicate that CuIn phase is formed originating from Cu₂In.

Key words: solar cell; CIGSe; magnetron sputtering; precursor; CuInGa

0 引 言

铜铟镓硒 (CIGSe) 薄膜太阳能电池具有光电 转换效率高、性能稳定、制造成本低廉等优点^[1-3], 被认为是一种非常具有应用前景的太阳能电池^[4-6]。 作为CIGSe薄膜太阳能电池最重要组成部分的 CIGSe吸收层的性能对于太阳能电池的性能起着至 关重要的作用,因此对CIGSe吸收层的制备工艺的 研究也是这一领域的研究热点。目前,制备CIGSe 吸收层的主要方法有共蒸发法^[7,8]、预制膜硒化两步 法、电沉积法^[9,10]、分子束外延法^[11]等,其中以共 蒸发法制备的CIGSe薄膜质量最好。具有19.9 %^[12]

收稿日期:2010-04-20;修回日期:2010-04-27 基金项目:*国家863项目资助(2007AA05Z461) 作者简介:李春雷(1983---),男(汉),辽宁沈阳人,博士生。 的最高转化效率的CIGSe太阳能电池即是采用共蒸 发法制备得到。但共蒸发法对于大面积CIGSe薄膜 太阳能电池模块的工业化生产而言,存在吸收层成 分和性能不易均匀的问题。采用磁控溅射方法制备 铜铟镓(CuInGa)合金预制膜再进行硒化制备 CIGSe薄膜的工艺方法(两步法)则在保证大面积薄 膜成分和性能的均匀性方面具有优势。

在该两步法制备CIGSe薄膜过程中,CuInGa预 制膜的成分和结构对随后硒化制备CIGSe吸收层的 硒化工艺以及CIGSe吸收层的成分、结构等性能有 着重要的影响。文中采用磁控溅射CuIn和CuGa合 金靶材的方法制备了CuIn、CuGa和CuInGa合金预 制膜,通过改变靶材的溅射功率研究了CuIn和 CuGa合金靶材的溅射特性,分析了CuIn、CuGa和 CuInGa合金预制膜的成分、结构特征,为进一步采 用硒化法制备性能优异的CIGSe薄膜的工作奠定了 基础。

1 试验方法

鉴于在常温下块体的CuInGa合金在很宽的成 分范围内仍有液相存在,本文在磁控溅射制备 CuInGa预制膜时选择了CuIn和CuGa二元合金靶 材,通过同时旋转交替溅射CuIn和CuGa靶材沉积 制备CuInGa预制膜。选择溅射二元合金靶材的方法 制备CuInGa预制膜的另一个优势在于在保持 Cu/(In+Ga)原子比基本不变的同时,可以很方便的 调节预制膜中Ga元素含量。

试验选用CuIn靶材的原子比Cu/In=0.96,简称 CI96,CuGa靶材的原子比Cu/Ga=1,简称CG。2种 靶材均在H₂气氛保护下熔炼制得,晶粒细小均匀, 纯度均大于99.99 %。靶材有效尺寸为120 mm× 250 mm。

磁控溅射采用双靶位中频交流磁控溅射设备, 设备示意图如图1。真空室为圆柱体,腔体壁上配 有两个靶位,靶位间夹角为120°。溅射时基片固定 在基片架上,旋转溅射时基片架以14 r/min的速度 旋转,基片与靶材表面距离50 mm。



图 1 溅射腔体俯视示意图 Fig.1 Schematic of the sputtering chamber

为了考察溅射电流对CuIn预制膜成分的影响, 选取6种CI96靶材溅射电流制备CuIn预制膜。基底 为玻璃片,玻璃片正对靶材固定不动。具体工艺参 数如表1所示。

为了考察溅射电流对CuGa预制膜成分的影响,选取6种CG靶材溅射电流制备CuGa预制膜。基 底为玻璃片,玻璃片正对靶材固定不动。具体工艺 参数如表2所示。

有文献指出^[13],采用Cu/(In+Ga)原子比在 0.69~0.98,Ga/(In+Ga)原子比在0.21~0.38范围内的

表1 制备 CuIn 预制膜工艺参数

Table 1 Parameters for preparing CuIn precursors

		<u> </u>		
样品 宛马	溅射电流 /^	溅射时间 /min	溅射压力	本底真空 /mPa
洲ケ	/A	/111111	AI/I d	/IIII a
CI01	0.06	30	1.0	3.0
CI02	0.12	30	1.0	3.0
CI03	0.16	30	1.0	3.0
CI04	0.20	30	1.0	3.0
CI05	0.24	30	1.0	3.0
CI06	0.28	30	1.0	3.0

表 2 制备 CuGa 预制膜工艺参数

Table 2 Parameters for preparing CuGa precursors

样品 编号	溅射电流 /A	溅射时间 /min	溅射压力 Ar/Pa	本底真空 /mPa
CG01	0.06	20	1.0	3.0
CG02	0.10	20	1.0	3.0
CG03	0.14	20	1.0	3.0
CG04	0.18	20	1.0	3.0
CG05	0.22	20	1.0	3.0
CG06	0.26	20	1.0	3.0

CIGSe吸收层就可以制备出高光电转换效率(~19%) 的太阳能电池。试验室先前研究发现:当CuIn、 CuGa靶溅射电流分别在0.2~0.3 A, 0.1~0.15 A范围 内时,可以制备出成分在上述范围之内的CuInGa 合金预制膜,因此文中选取了具有代表性的CuIn靶 溅射电流0.28 A, CuGa靶溅射电流0.1A的工艺参数 制备CuInGa预制膜,并分析了CuInGa预制膜组织 结构和成分。CuInGa预制膜的具体制备工艺参数如 表3所示,溅射气体Ar压力为1.0 Pa。

表 3 制备 CuInGa 预制膜工艺参数

Table 3 Parameters for preparing CuInGa precursors				
样品 编号	靶材	溅射电流/A	溅射时间 /min	本地真空 /Pa
CuInCa	CI96	0.28	00	2.0×10^{-3}
CumGa	CG	0.10	90	3.0~10

2 结果与讨论

2.1 溅射电流对薄膜成分的影响

采用X射线荧光(XRF)分析方法对所制备的 CuIn、CuGa、CuInGa预制膜进行成分测试。CuIn、 CuGa预制膜的Cu/In和Cu/Ga原子比结果如表4所示。 从表4中可以看出,对于CI96靶材,随着溅射电

表 4 Culn 和 CuGa 预制膜的成分	(原子数分数)
Table 4 Compositions of CuIn and	CuGa productor

Table 4 Compositions of Cum and CuGa precursors			
样品	Cu/In	样品	Cu/Ga
CI01	1.10	CG01	1.05
CI02	1.04	CG02	1.06
CI03	1.00	CG03	1.06
CI04	0.92	CG04	1.05
CI05	0.88	CG05	1.02
CI06	0.87	CG06	1.00

流的增加,CuIn预制膜中的Cu/In原子比逐渐减小, 说明CuIn靶材存在比较明显的选择性溅射。随着溅 射电流的增加,靶材中的In的溅射产额逐渐增加, 薄膜中In的含量因此也随之逐渐增加。对于CuGa 靶材,随着溅射电流的增加,CuGa预制膜中的 Cu/Ga原子比几乎没有变化,并且近似等于靶材的 Cu/Ga原子比,说明CuGa靶材没有选择性溅射。

CuInGa 预 制 膜 的 XRF 检 测 结 果 显 示, Cu/(In+Ga)原子比为0.90,Ga/(In+Ga)原子比为0.23, 均在理想的成分比例范围内,这也说明通过适当溅 射功率参数的选择可以通过溅射CuIn、CuGa合金靶 材制备成分比例合适的CuInGa合金预制膜。

2.2 薄膜的组织结构

采用XRD方法分析了CuIn和CuInGa预制膜组 成相的晶体结构。从检测结果中发现:对于CuIn预 制膜,随着溅射电流的增加薄膜衍射谱中衍射峰数 量和位置都发生了改变,说明薄膜的组成相发生了 变化。

图2和图3是样品CI02和CI06的XRD衍射谱,为 便于说明CuIn预制膜组成相随溅射电流的增加而 改变,CuIn和Cu₂In的标准X射线衍射谱亦列于图2 和图3中。



图 2 CI02 薄膜衍射谱 Fig.2 XRD patterns of the CI02



图 3 CI06 薄膜衍射谱 Fig.3 XRD patterns of the CI06

从图2中可以看出CI02衍射谱中出现了较强的 Cu₂In相衍射峰,在P1、P2位置还出现了相对微弱 的单质In相的衍射峰,在标准卡片中没有对应P_x衍 射峰位置的Cu-In相,但对比Cu7In3、Cu4In相的标 准卡片(65-2249,42-1477)可以推测Px衍射峰位置应 该对应于富Cu的Cu-In相。结合样品CI02的XRF分 析结果,可以定性的认为CI02薄膜主要由Cu₂In、In 相组成。对比标准Cu₂In衍射谱(42-1475),可以发 现试验所制备的CI02薄膜中的Cu₂In相具有(212) 方向择优生长的特点。从图3中可以看出CI06薄膜 的衍射谱中除了Cu₂In的衍射峰外还出现了较强的 CuIn和In相的衍射峰,可以认为CI06薄膜主要由 Cu₂In、CuIn、In相组成。CuIn相的形成原因可能是: 一方面,提高溅射电流增加了CuIn靶材中的In原子 的溅射产额,使得薄膜中In含量增加,促进CuIn相 的生成;另一方面,当提高溅射电流时,相应的溅 射电压增加,提高了溅射原子Cu、In的能量,增加 了原子在薄膜中的扩散长度,促进Cu₂In相逐渐向 CuIn相的转变。

图4是CuInGa预制膜的XRD衍射谱,可以发现 在衍射谱中,出现了Cu₂In、CuIn、In相的特征衍射 峰,但并没有因为Ga的加入而出现新的衍射峰,说 明CuInGa预制膜主要由Cu₂In、CuIn、In三相组成,



图 4 薄膜 CuInGa 衍射谱 Fig.4 XRD patterns of the CuInGa

Ga元素则是以固溶的形式存在于Cu₂In、CuIn、In 相之中。

3 结 论

(1) 对于CuIn靶材,随着溅射电流的增加,CuIn 预制膜中的Cu/In原子比逐渐减小;对于CuGa靶材, 随着溅射电流的增加,CuGa预制膜中的Cu/Ga原子 比保持不变。

(2) 在制备CuIn预制膜时,CuIn薄膜主要由Cu₂In、CuIn、In相组成,随着溅射电流的增加,薄膜中In含量增加,薄膜的组成相Cu₂In逐渐转变为CuIn相。

 (3)当Cu/(In+Ga)=0.9,Ga/(In+Ga)=0.23时, CuInGa薄膜主要由Cu₂In、CuIn和In三相组成,Ga 元素以固溶的形式存在于混合相之中。

参考文献:

- Jef Poortmans, Vladimir Arkhipov. Thin film solar cells fabrication, characterization and applications [M]. John Wiley & Sons Ltd, 2007: 237-238.
- [2] Breeze A J, et al. Next generation thin–film [C]. 2008 IEEE International Reliability Physics Symposium Proceedings, 2008, 46th ANNUAL: 168-171.
- [3] Hayashi T, Minemoto T, Araki T, et al. Fabrication of Cu(In,Al)Se₂ solar cells by three–stage evaporation process [J]. Photovoltaic Cell and Module Technologies, 2007, 6651: 6510.
- [4] Van Duren JKJ, Leidholm C, Pudov A, et al. The next generation of thin-film photovoltaics [J]. Thin-Film Compound Semiconductor Photovoltaics, 2007, 1012: 259-268.
- [5] Solar energy technologies programs: national solar technology roadmap: CIGS PV (USA) [R]. 2007, 06.
- [6] Green M A. Recent development in photovoltaics [J]. Solar Energy, 2004, 76: 3-8.
- [7] Drici A, Mekhnache M, Bouraoui A, et al. Cu(In1-xGax)Se₂ co-evaporated thin films from simple tungsten baskets-influence of the gallium source [J]. Materials Chemistry and Physics, 2008, 110(1): 76-82.
- [8] Miguel A. Contreras, Manuel J. Romero, Noufi R. Characterization of Cu(In, Ga)Se₂ materials used in record performance solar cells [J]. Thin Solid Films,

2006, 511-512: 51-54.

- [9] Oda Y, Minemoto T, Takakura H, et al. Cu(In, Ga)Se₂ prepared from electrodeposited CuGaSe₂/CuInSe₂ bilayer for solar cell applications [J]. Thin–Film Compound Semiconductor Photovoltaics, 2007, 1012: 475-480.
- [10] Ihlal A, Bouabid K, Soubane D, et al. Comparative study of sputtered and electrodeposited CI(S, Se) and CIGSe thin film [J]. Thin Solid Films, 2007, 515(15): 5852-5856.
- [11] Xu HY, Papadimitriou D, Zoumpoulakis L, et al. Compositional and temperature dependence of the energy band gap of CuxInySe₂ epitaxial layers [J]. Journal of physics Applied Physics, 2008, 41(16): 165102.
- [12] Ingrid Repins, Miguel A. Contreras brian egaas.
 19.9%–efficient ZnO/CdS/CuInGaSe₂ solar cell with 81.2 % fill factor [J]. Progress in Photovoltaic, 2008, 16: 235-239.
- [13] Philip Jackson, Roland Würz, et al. High quality baseline for high efficiency Cu(In1-x, Gax)Se₂ solar cells [J]. Prog. Photovolt. Res. Appl., 2007, 15: 507-519.

作者地址:北京市清华大学 100084 机械工程系西主楼 3 区 501 Tel: 13810672365 E-mail: li-cl02@mails.thu.edu.cn

- [3] McLaren A D, Li T T, Robert Rager, et al. The meaning
- of tack temperature [J]. Journal of Polymer Science. 1951, 7: 463-471.
- [4] McBain J W, Hopkins D G. On adhesives and adhesive action [J]. The Journal of Physical Chemistry . 1925, 1: 188-204.
- [5] 沈德言. 红外光谱法在高分子研究中的应用 [M]. 北京: 科学出版社, 1982.
- [6] Yamabe H. Stabilization of the polymer metal interface[J]. Prog Org Coat, 1996, 28: 9-15.

110016

作者地址: 沈阳市东陵区文萃路 62 号 Tel: (024) 23915900 E-mail: wuhang@imr.ac.cn